

#### 本記事は, 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 技術スタッフ表彰について紹介するものです.



# 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム 令和元年度技術スタッフ表彰 若手技術奨励賞 FIB-SEM を用いた微細構造解析支援 受賞者 北海道大学 微細構造解析プラットフォーム 遠堂 敬史氏に聞く

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 では、全国37の研究機関で最先端ナノテクノロジー 設備の利用機会を設備使用のノウハウとともに、産学 官の研究者に対して提供している. 最先端研究設備の 有効利用には、設備の特徴を熟知して整備し、利用者 に使用ノウハウを提供する技術支援スタッフの存在が 大きな支えになっている. 令和元年度の若手技術奨励 賞は、北海道大学の微細構造解析プラットフォーム (PF) 高度専門技術者, 大学院工学研究院 共同利用施 設 ナノ・マイクロマテリアル分析研究室の技術職員, 遠堂敬史(えんどう たかし)氏に贈られた [1]. 受賞 テーマは「FIB-SEM を用いた微細構造解析支援」であ る. 表彰式は第19回国際ナノテクノロジー総合展・ 技術会議 (nano tech 2020) セミナー会場で行われ, 受賞内容はナノテクノロジープラットフォームのブー スに展示された. nano tech 2020 が開かれた東京ビッ グサイトの一室で,遠堂氏に受賞した技術の内容,支 援の状況,今後の抱負など,苦労話も含めお話を伺っ te.



展示パネル前で若手技術奨励賞の表彰状を手に遠堂氏

# 1. 北海道大学 微細構造解析プラット フォームの概要

北海道大学の微細構造解析 PF は,図1に示すように 「先進ナノ構造・状態解析の共用拠点」と位置づけ,学内 外の研究者が最先端の計測設備を利用できる[2]. 無機材 料から生体組織に至る多様な試料を対象とし,試料表面 から内部まで一貫した構造解析支援を行っている.設備・ 支援業務は,大きく以下の3分野に分けられる;

#### (1) 表面構造解析;

走査型電子顕微鏡(SEM),走査プローブ顕微鏡(SPM), X線光電子分光装置(XPS),オージエ電子分光装置(AES),電子線プローブマイクロアナライザー (EPMA),等の表面分析装置による表面構造解析

#### (2) 内部構造・3D 構造解析;

. . . . . . . . . .

2台の高エネルギーイオン加速器を持つ世界に唯一 の超高圧(1000kV)電子顕微鏡,透過型電子顕微 鏡(TEM),走査透過型電子顕微鏡(STEM),に加 えて試料加工装置と組合わせた集束イオンビーム-走査型電子顕微鏡(FIB-SEM)等による内部構造・3 次元構造解析

#### (3) 電子状態解析;

環境セルホルダーを用いたその場観察 TEM や,超 高真空・極低温・強磁場 SPM を用いた環境制御下 での分析支援,超高速時間分解光電子顕微鏡や高速 スペクトルイメージング対応レーザー共焦点顕微鏡 等を用いた電子状態やナノ材料のリアルタイム動態 解析

北海道大学の微細構造解析 PF では、図2上に示すよ

## ~先進ナノ構造・状態解析共用拠点~

・各種ナノ計測設備群と計測技術を応用した多種多様な解析技術の提供
 ・無機材料から生体材料にいたる多様なマテリアルのナノ構造・状態解析
 ・材料の表面・表層から内部に至る一貫した包括的な先進微細構造解析
 ・ナノテクノロジーを活用した材料研究分野における学問的課題を解決
 ・産業界の研究者が有する技術的課題を解決し、イノベーションを加速
 ・知の集約による産学官連携による異分野融合と最先端計測人材の育成



図1 北海道大学 微細構造プラットフォームの概要 [2]

うに毎年約100件の利用がある.図2中央の円グラフは 利用ユーザの所属割合で,約6割が学外であり,他大学 が3割,企業が2割,公的機関の利用が1割となってい る.図2下の円グラフは利用形態別の割合で,機器利用 が73%を占め殆どであるが,技術代行も14%と道内の 遠く離れた機関の場合は多い.技術代行の場合でも,最 初の解析はユーザーとPFスタッフが一緒に測定・解析を 行い,次に解析する試料は郵送してもらってスタッフが 測定評価している.

初めて PF を利用する場合には、利用料や旅費などを支援する試行的利用制度 [3] を使ったユーザもいる.時間や 費用の事前見積りが難しい案件や、これまでに取り扱っ たことがない試料・分析手法を用いる案件などが対象で、 PF の支援者側にとってもメリットがある制度である.「挑 戦的な案件に、支援者として積極的に取り組むことで、 スキルアップできる機会になっている.」と遠堂氏は語っ た.



#### 2.1 FIB-SEM 装置の構造と原理

遠堂氏が担当している装置は、SEM, EPMA, TEM, FIB-SEM の 4 台で,年間 30 件程の支援を行っている. 今回の受賞対象装置である FIB-SEM (Focused Ion Beam Scanning Electron Microscope,集束イオンビーム加工・ SEM 観察装置)は、試料に Ga イオンを打ち込んで、試 料を切削する(穴を掘る、薄層を削り取る)加工装置で、 加工した状態を SEM 観察できる.SEM 観察画面上に、加





H30年度利用件数のユーザー所属割合



H30年度の利用形態別割合

図2 北海道大学 微細構造プラットフォームの支援件数推移(上), ユーザ所属割合(中),利用形態別割合(下) 工したい部分を指定すると,指定された部分が自動的に 加工される.加工深さは,Gaイオン照射強度や照射時間 で制御する.加工と観察を繰り返して,試料内部の3次 元構造を解析することが可能である.

図3は、FIB-SEM 装置の外観(左)と、試料室内部を 横から撮影した拡大写真(右)である。FIB-SEM は図3(右) 上部に一部が見えている FIB と SEM の二つの鏡筒を持ち、 SEM は電子線を試料に照射して放出された二次電子を検 出、電子線を走査して画像化する。図4は FIB 鏡筒の構 造(右)と、Ga イオンを照射した試料表面部を拡大して、 試料が削られてスパッタリング原子が飛び出すほか、試 料表面から二次電子ほかが発生する様子を描いている(左 下).Ga イオンが上方から加速集束されて試料に照射さ れると、試料表面からは二次電子やスパッタリング原子 の他,X線,後方散乱イオンなど様々なものが発生する. 発生した電子,X線,イオン,等を,図3右の写真に示 した複数の検出器で検出することにより,FIBは加工装置 であるとともに画像観察装置にもなる.FIB-SEMでは二 次電子の検出器を SEM と併用する.

SEM は、ショットキー型 FE (電界放射) 電子銃からの 細い電子線を 0.2 ~ 30kV の電圧で加速する.加速電圧 30 kV における画像の分解能は 1.2nm である.SEM は以 下の 4 つの検出器、およびオプション機能を持つ.FIB で 薄層を反復して削り、その都度、取得した SEM 画像のデー タを集積して、画像解析する事により 3 次元画像を構築 できる.FIB 加工と SEM 観察とを同一試料室内で行うので、 大気非暴露の観察ができる.





図4 FIB-SEMの構造(右)と照射試料面から発生する様子(左下)

- SED (Secondary Electron Detector)は、試料から放出された二次電子を検出し、試料表面のSEM 画像を形成する.
- ② EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) は、 電子線照射による発生する特性 X 線を検出し、エ ネルギー分光することで元素分析する。
- ③ EBSD (Electron Back Scattered Diffraction Pattern)は、電子線照射した試料の結晶面から の後方散乱回折電子パターンを検出し、試料内部 の結晶方位分布を解析する.
- ④ BEI (Backscattered Electron Imaging)は、照射 電子がエネルギーをほとんど失わずに試料外に後 方散乱されたものを検出し、原子番号・試料面角 度依存性がある組成像、凹凸像として利用される.

FIBから放出されたイオンを1~30kVの電圧で加速し, 試料の切削加工を行い,二次電子を検出して画像化する. 像の分解能は加速電圧 30kV において 5nm である.図3 下の仕様表に示したように,カーボン(C)やタングステン(W)の保護膜を試料表面に蒸着成膜する機能がつい ている.FIB 加工する前に,Ga イオンビームによるエッ チングを防ぐために,加工部周辺の表面に保護膜を蒸着 しておく.

### 2.2 FIB-SEM 装置の利用事例

上述の FIB-SEM 装置の機能について、図5は、FIB-

(1) 試料断面の観察・元素分析
 C
 Au
 Ni
 Cu

断面加工後、そのまま元素分析

北海道科学大学 工学部 見山克己先生 [A-12-HK-0055, 他]



SEM 装置でどんな加工・観察・解析ができるのかを,遠 堂氏が担当した支援事例の中から,4つに分類して示して いる.

#### (1) 試料断面の観察・元素分析;

金メッキした試料のメッキ不良部の断面を観察する ために, FIB で試料を切削していって不良部の穴の 断面を切り出し(左白黒写真), 直ぐに EDS スペク トルから切削断面の元素マッピングした例である (右カラー写真). Ni の層に, Au が穴に沿って入っ ている.

#### (2) TEM 観察用 薄膜試料作製;

Si 基板上の量子ドット試料に対して,TEM 観察用に 50nm 厚さまで試料を薄く加工した例である.

#### (3) 3次元結晶方位解析;

ステンレス鋼の破断試料に対して,結晶面が (111) 面(青色)と (001) 面(赤色)が交互に積層して, どのようにつながっているかを, FIB 加工 (50nm 毎のスライス)と SEM 観察を繰り返して 3 次元化 した例である.結晶方位は EBSD のカメラで撮像し, 回折像解析ソフトウェアで結晶面向きをマッピング している.3次元化には連続 72 時間かかるが,測 定評価は自動化されている.EBSD による 3 次元結 晶方位解析は, 3.3 節でも紹介する.

#### (4) 大気非暴露観察·分析;

Li系の試料を大気に暴露することなく,TEM 観察・ 分析ができる.

#### (2) TEM 観察用 薄膜試料作製



北海道大学 情報科学研究院 村山明宏先生 [A-19-HK-0064, 他]



リチウム・硫化物材料の取り扱いが可能 北海道大学創成研究機構 王永明先生 [A-18-HK-0034, 他]

図 5 FIB-SEM の利用事例



#### 3.1 支援事例 1: 超硬合金の断面観察·元素分析 [4]

北海道内の企業で,放電プラズマ焼結装置でナノ粒子 を焼結して超硬合金を作っている企業が利用者である. 超硬合金の一部に,強度が弱い部分が出てきてしまう問 題があり,材料表面だけでなく内部を高解像度で観察し たい,という要望があった.

当初は試行的利用制度を利用して,FIB-SEM で内部を 観察してみることにした.鋳型用に作られた超硬合金の ため,極めて固く,加工に長時間を要したが,内部観察 に成功した.図6が,その結果である.放電プラズマ焼 結した超硬材料(平均粒径 0.2µm の炭化タングステン) の表面研磨した面には研磨加工傷が見られるが(図6左 上),FIB 加工して研磨面から 50µm 彫り込んだ側壁面を 観察すると焼結体として粒子が相応の結合状態になって いる(図6左下).ただ一方で,焼結された組織間の粒径 差が著しいごく一部の箇所に 0.1µm 程の粒子間空隙があ る事がわかった(図6右下).

そこで、試行的利用から本格的利用に移行して、粒子

間空隙フリーを目指してプロセス改善と FIB-SEM 観察を 3年間にわたって継続し,原料粉末内の粗粒子を徹底排除 することが重要と判明した.「高品質の超高合金製品とす ることに貢献したとともに,微細構造解析 PF としても超 硬合金の FIB 加工ノウハウを蓄積することができ,支援 範囲を広げることに繋がっている」と遠堂氏は振り返っ た.

## **3.2 支援事例2:骨組織細胞群の3次元構造観察**[5] [6][7]

学内の医学系の先生からの依頼で, 骨組織のナノレベ ル微細3次元構造解析を支援した事例である. 生物系の 試料を対象にするもので, FIB-SEM での解析に適した試 料作製方法から検討しなければならず, 先ずは試行的利 用制度を利用してスタートした.

試料はマウスの脛骨(下肢の内側にある長い骨)で, 脱灰・染色・脱水処理した後に,エポキシ樹脂で包埋した. ウルトラミクロトームで試料表面を滑沢にした後,SEM 観察して3次元加工・観察する領域を決定した.加工領 域に保護膜を施してから,加速電圧30kVでGaイオンを 照射して50nm間隔でスライス加工と,SEMによる断面 観察を連続して繰返した(シリアルセクショニング).



図6 超硬合金の FIB-SEM による内部断面観察 [4]

図7左は、FIB-SEM 装置を用いてシリアルセクショニ ング法で撮像した SEM 像を 3 次元構築ソフトウェアで 再構築して得た 3 次元構造解析画像(3D解析した領域 は 25 × 20 × 20µm)である.図7右は、FIB スライス 加工した断面からの SEM 像で、スライス加工を 350 回 繰り返して行った毎に撮像した SEM 像を重ね合わせたも のである(右下の白色棒は 5µm).写真右側や左下の塊 が骨細胞(osteocyte)、写真上部に見えるのが骨芽細胞 (osteoblast)、それらの間を連結する細かな細胞突起の ネットワークである.こうした骨細胞や骨細管系の 3 次 元構造の解明は、骨細胞のミネラル代謝調節などの機能 を解明するうえで非常に有益な情報を与える.

図7のような3次元構築像を得るには、実はPF支援 者の並々ならぬ努力、辛抱強い作業の積み重ねがあった. 図8で、その作業を説明する.図8左は、FIB加工した 断面スライスをSEM観察した像を3枚だけ重ねている. 各写真の左上に骨細胞が見える.各写真の中央部は、殆 どが黒くなっており、試料を樹脂で埋設して固定した部 分である.黒い領域の中に、良く見ると白い線が所々に 出ている.これは、細胞突起のネットワークがその断面 でぶつ切りされて出現しているものである.シリアルセ クションして得た350枚のSEM写真を重ねただけでは、 細胞突起のネットワークは黒い樹脂に覆われてしまい、 ネットワーク構造は解析できない.「顕微鏡学会の分科会 に参加したところ、学会の同業者たちが皆同じような課 題に直面していました.その課題解決には、画像から切 り出したいところを丁寧に手でなぞるのが、結局一番き れいに再構成できる」と、遠堂氏は意を決した.

そこで、遠堂氏は1枚のSEM写真に対して、ペンタ ブレットを使って手作業で白い細胞突起部を切り出して、 それらを350枚にわたって接続することで、細胞突起の 3次元ネットワーク構造を再構築した.図8右がその結 果であり、写真中央部に、細胞突起の3次元ネットワー ク構造が明瞭に見える.350枚のセクションスライス



3次元構築画像



FIB加工断面箇所の反射電子像 (350枚を重ねたもの)

北海道大学 歯学研究院 長谷川智香先生 [A-14-HK-0026, ナノプラ試行的利用制度 NPS14034, 他]
 図7 マウス骨組織の FIB-SEM シリアルセクショニング法による内部構造の可視化 [7]



 断面スライス像(SEM)
 3D 構築像

 図8 骨組織の断面スライス SEM 像(左)と3D 構築像(右)[7]

SEM 像を取得するのは,自動化されているので丸1日あればできる.しかし,手作業でのSEM 像処理を350枚に対して行うには,桁違いの時間と辛抱強さが要求される. 骨組織細胞群の3次元構造解析は,こうしたPF支援者の苦労と汗の結晶であることがわかった.

#### 3.3 支援事例 3:ナノロッドの結晶方位解析 [8]

北見工業大学の先生から,ナノロッドの結晶成長方位 を解明する研究の支援を求められた.北見は札幌から遠 距離であり,本支援も試行的利用制度に応募して始めた.

FIB-SEM 装置には、電子線後方散乱回折(EBSD)測定 装置が組み込まれており、結晶方位の解析ができる.

図9は,電子線後方散乱回折法(EBSD)の測定原理(左) と,Ni 試料の結晶方位を解析した例である.試料からの 後方散乱電子は,試料を構成する結晶からの回折電子パ ターンとして CCD カメラで検出される.試料に入射する 電子ビームをスキャンすることで,図9右の粒界マップ と、各粒界の結晶方位を回折パターンから解析した方位 マップを得る.方位マップは電子回折パターンから自動 解析ソフトウェアで,(111)面を青色,(001)面を赤色, 等とカラーでマップ表示される.

北見工大からは, Si 基板上に酸化亜鉛 (ZnO) のナノロッド (量子ドット)を結晶成長した試料に対して,各ナノロッドの成長が結晶方位として揃っているのか, どんな様子かを明らかにしたい, との要請があった.

図 10 左は、酸化亜鉛のナノロッドを試料に対して正面 から観察した SEM 像で、六角形のロッド断面構造が見ら れる.写真右上は、試料の断面 SEM 写真で、Si 基板から ナノロッドがほぼ垂直に成長している様子が見られる(目 盛尺は 1µm). この試料に対して EBSD 測定して、一つ一 つのナノロッドの結晶方位を評価した結果を、極点図と して表現した結果が図 10 右である.極点図は各ナノロッ ドの結晶方位分布を、六方晶の底面である(0001) に対し て、結晶成長が Si 基板に垂直になっている場合が、極点 図の中心になるようにし、垂直から傾くと TD (Transverse



図9 電子線後方散乱回折法(EBSD)による Ni 結晶方位解析



Direction)横方向,あるいは RD (Rolling Direction) 圧 延方向にプロットしたものである。色分けは,青色が低 頻度,赤色が高頻度で,赤色は青色より 10 倍以上頻度が 高いことを示している。図 10 右の極点図解析結果は,ナ ノロッドの結晶成長が中心の赤色部に集中していること を意味している。

実は、この結果を得るに至るまでに、紆余曲折があった. 当初はナノロッド1本ずつ測定する予定であったが、 電気伝導率が悪く、SEM 観察が難しかった. そこで、導 電性を確保するためにカーボンコートを行ったが、コー トが厚くなると結晶方位解析が難しくなる. 結局、FIB の EBSD で回折パターンを確認、カーボン蒸着を交互に繰り 返すことで、EBDS 測定と、ドリフトやチャージが抑えら れる妥協点を探して、何とか測定することができた.



遠堂氏は,北海道大学の微細構造解析 PF での技術支援 スタッフとして約5年,様々な支援活動に携わった. PF 利用者が提供する試料について,なにか一つでも多くの データや知見が得られるように支援してきた.そうした 支援活動の中でも,これまでに経験したことがないよう な,少々困難な依頼が来るたびに,何とか対応しようと 努めてきた.骨組織細胞群の3次元構造観察,ナノロッ ドの結晶方位解析,等いずれの支援例でも,測定装置は 自動化されているものの,観察対象の試料の準備や観察 画像データの3次元化構築において,遠堂氏のような技 術支援スタッフの並々ならぬ努力があって初めて研究成 果が得られていることに感銘を受けた取材であった.

「挑戦的な課題であるほど,支援する技術スタッフのス キル向上の機会にもなっている.今後も難しい課題であっ ても遠慮なく相談しに来て欲しい」,と遠堂氏は語った. 本記事の読者が,北海道大学の微細構造解析 PF を利用し てみたい,との気持ちを持つきっかけになれば幸いである.



- [1] ナノテクノロジープラットフォーム技術スタッフ表 彰,令和元年度,若手技術奨励賞 遠堂 敬史(微 細構造解析 PF 北海道大学):https://www.nanonet. go.jp/ntj/award/
- [2] 北海道大学 ナノテクノロジープラットフォーム 微

細構造解析 PF:http://www.cris.hokudai.ac.jp/cris/ nanoplat/

- [3] 2019 年度試行的利用制度:https://www.nims.go.jp/ acnp/shikou.html
- [4] 安藤 秀夫,遠堂 敬史,笠 晴也,松尾 保孝,東陽介," 放電プラズマ焼結装置を用いた超硬材開発における 問題解決から新超硬金型開発へ ~ナノテクプラッ トフォームの地域中小企業支援~", NanotechJapan Bulletin Vol. 8, No. 5, 企画特集「Collabo ナノテクノ ロジー」(第6回)(2015): https://www.nanonet. go.jp/ntjb\_pdf/CollaboNano-06.pdf
- [5] 長谷川 智香,山本 知真也,網塚 憲生,小澤 英浩, 遠堂 敬史, "FIB-SEM を用いた骨組織の 3 次元微 細構造解析 ", NanotechJapan Bulletin Vol. 7, No. 5,企画特集「ナノテクノロジー EXPRESS」(第 29 回)(2014):https://www.nanonet.go.jp/ntjb\_pdf/ nanotechEXPRESS-29.pdf
- [6] Tomoka Hasegawa, Takashi Endo, Erika Tsuchiya, Ai Kudo, Zhao Shen, Yasuhito Moritani, Miki Abe, Tomomaya Yamamoto, Hiromi Hongo, Kanako Tsuboi, Taiji Yoshida, Tomoya Nagai, Naznin Khadiza, Ayako Yokoyama, Paulo Henrique Luiz de Freitas, Minqi Li, and Norio Amizuka, "Biological application of focus ion beam-scanning electron microscopy (FIB-SEM) to the imaging of cartilaginous fibrils and osteoblastic cryptoplasmic processes", Journal of Oral Biosciences, Vol.59, No.1, pp55~62 (2017)
- [7] Tomoka Hasegawa, Tomomaya Yamamoto, Hiromi Hongo, Zixuan Qiu, Miki Abe, Takuma Kanesaki, Kawori Tanaka, Takashi Endo, Paulo Henrique Luiz de Freitas, Minqi Li, Norio Amizuka, "Three-dimensional ultrastructure of osteocytes assessed by focused ion beam-scanning electron microscopy (FIB-SEM)", Histochemistry and Cell Biology 149, pp423~432 (2018)
- [8] Kyung Ho Kim, Yuya Yoshihara, Yoshio Abe, Midori Kawamura, Takayuki Kiba, and Takashi Endo, "Effects of Ni dopant on structural properties of zinc oxide nonorods", Microelectronic Engineering, 165, pp20~22 (2016)

(図はすべて遠堂氏から提供された)

(尾島正啓)